半導体パッケージの製造方法およびその成形用 金型

特開2000-12578

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特別2000-12578

(P2000-12578A)

(43)公開日 平成12年1月14日(2000,1.14)

(51) Int.Cl.7

兼別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01L 21/56

HO1L 21/56

T 5F061

審査請求 有 請求項の数6 OL (全9頁)

(21)出職番号

特膜平10-179179

(22)出版日

平成10年6月25日(1998.6.25)

(71)出職人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 鶴田 久幸

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100064621

弁理士 山川 政樹

Fターム(参考) 5F061 AA01 BA05 CA21 DA03 DA05

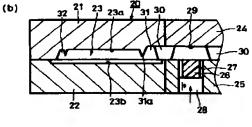
DA07

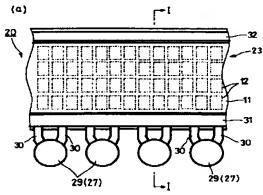
(54) 【発明の名称】 半導体パッケージの製造方法およびその成形用金型

(57)【要約】

【課題】 複数の半導体パッケージを構成する板状のパッケージパネルを、樹脂の未充填箇所がなく、ワイヤ流れ、倒れ等のワイヤへの悪影響がない状態で成形できるようにする。

【解決手段】 多数の半導体素子12を実装した絶縁フレーム11の主面上に全面にわたって一連に樹脂封止するための成形用金型20において、キャビティ23の長辺部分にその長さをほぼ等しい長さでゲート31を設ける。このゲートに対して成形用金型の一部に設けたポット27からロングゲルタイプの熱硬化性樹脂による溶融樹脂26をカル29、ランナ30を介して供給することにより、前記ゲートを介してキャビティの長辺部分から溶融樹脂を全面にわたって均一に充填する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁フレームの主面上にマトリックス状に実装した多数の半導体素子をトランスファ成形により 樹脂封止することにより、複数の半導体パッケージを形成する半導体パッケージの製造方法であって、

前記半導体素子を実装した絶縁フレームを成形用金型のキャピティ内に配置し、

前記成形用金型に設けたポットから溶融樹脂をランナを 介して供給し、

前記キャビティの長辺部分にその長さとほぼ等しい長さ で設けたゲートを介して前記溶融樹脂を充填することに より、面方向に連続する平らな面をもった板状のパッケ ージパネルを成形し、

このパッケージパネルを前記半導体パッケージ毎に切断 することを特徴とする半導体パッケージの製造方法。

【請求項2】 請求項1に記載の半導体バッケージの製造方法において、

前記絶縁フレームとして、絶縁基板または絶縁テープの いずれかを用いたことを特徴とする半導体パッケージの 製造方法。

【請求項3】 絶縁フレームの主面上にマトリックス状に実装した多数の半導体素子をトランスファ成形により樹脂封止することにより、面方向に連続する平らな面をもち複数の半導体バッケージを構成する板状のバッケージパネルを製造する半導体バッケージの成形用金型であって、

前記半導体素子を実装した絶縁フレームを配置するキャ ピティと、

このキャビティ内に複数のランナおよびゲートを介して 溶融樹脂を供給するポットとを備え、

前記ゲートを、前記キャビティの長辺部分に沿ってその 長さとほぼ等しくかつ長さ方向に連続した平行な隙間に よって形成したことを特徴とする半導体バッケージの成 形用金型。

【請求項4】 請求項3に記載の半導体パッケージの成形用金型において、

前記溶融樹脂を供給するポットが複数個であることを特 徴とする半導体パッケージの成形用金型。

【請求項5】 請求項3または請求項4に記載の半導体 パッケージの成形用金型において、

前記キャビティのゲートと反対側の長辺部分にダミーキャビティを設けたことを特徴とする半導体パッケージの成形用金型。

【請求項6】 請求項5に記載の半導体パッケージの成形用金型において、

前記キャビティとダミーキャビティとの間に、前記キャビティの長辺部分に沿ってその長さとほぼ等しくかつ長さ方向に連続した平行な隙間を設けたことを特徴とする 半導体バッケージの成形用金型。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はたとえばTBGA (tapeBGA; ball grid array)、PBGA(plasti cBGA)、FPBGA(fine pitchBGA)あるいは 05 CSP(chip size package)等の半導体パッケージの 製造方法およびその成形用金型に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置のうち、たとえばPBGAやCSP等のようにボールグリッドによる表面実装タイプ10の半導体バッケージが、電子機器の小型、薄型、軽量化の要求から近年盛んに採用されるようになっている。この種の半導体バッケージは、たとえば特開平9-252065号公報や特開平9-36155号公報に示されるように、ガラエポ基板(ガラス繊維入りエポキシ樹脂基15板;絶縁基板)またはポリイミドテープ(絶縁テープ)等の長尺な絶縁フレーム上に多数の半導体素子(半導体チップ)を配列して実装し、一つまたは複数個の半導体素子毎に封止樹脂で樹脂封止し、外部との接続用のボールバンプをフレームの裏面に付設したものを、ポンチと20ダイとからなる切断金型で切断することによって製造されていた。

【0003】上述した従来の半導体バッケージの製造時において、絶縁フレーム上に配列した半導体素子の樹脂封止は、上述したように一つまたは複数個の半導体素子を半導体バッケージとして樹脂封止する複数のキャピティを有する成形用金型を用いて行われている。上述した成形用金型では、一つの半導体バッケージを構成するキャピティに対して一つのゲートを設けるとともに、このゲートに対し溶融樹脂を供給するポットがランナを介して接続されている。

【0004】従来の半導体パッケージを樹脂封止する成形用金型では、各キャピティのコーナ部あるいはキャピティの一辺のセンタ部等に、たとえば1~2mm程度の幅でゲートを設けていた。

35 【0005】また、たとえば特開平6-244313号公報に示すように、複数の半導体素子を一方向に並んで連設させ、これらの半導体素子を外部接続用のリード材とともに一括して樹脂封止するようにしたSOJ型の半導体パッケージも提案されている。そして、この半導体40 パッケージでは、一方向に並べた半導体素子を、分割領

40 ハッケーンでは、一方向に並べた手等体系子を、分割領域に相当する封止樹脂の肉厚を薄くし、全体にわたって 一括して樹脂封止することが記載されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した特開昭9-252065号公報、特開平9-36155号公報に記載されている半導体バッケージによれば、製造時において絶縁フレーム上に半導体素子を配列する際に、ポンチとダイとによる切断代を設ける必要があり、絶縁フレームに無駄な部分が多く生じるばかりでなく、切断部位にチッピングを生じたり、切断屑による汚

れを生じたりすることがあった。そして、このような従 来の半導体パッケージの製造にあたっては、絶縁フレー ム上に多数の半導体素子を並べ、これらを一括して樹脂 封止することができないものであった。

【0007】また、上述した半導体バッケージにおいて製造コストは、従来一般的であった金属製リードフレームを用いたQFPやTSOPのような半導体バッケージに比べて、資材コスト(特にガラエポ基板、ポリイミドテープ等の基材の資材コスト)が大きく相違していることによって、かなりコスト高となっている。したがって、BGA、CSP等の半導体バッケージでは、上述した基材の使用効率を向上させることにより資材コストを低減することが重要課題となっている。たとえば上述した従来例では、基材の使用効率(製品として有効な領域)は約50%程度のものが多い。

【0008】このような成形用金型構造を簡素化し、また絶縁フレーム基材の使用効率を向上させるために、後で述べるように、本発明者らは絶縁フレーム上に多数の半導体素子をマトリックス状に実装し、これらを全面にわたって一連に樹脂封止することにより面方向に連続する平らな面をもった板状のパッケージパネルを形成し、このパッケージパネルを切断することにより半導体パッケージを製造する方法を考えている。

【0009】しかし、上述した絶縁フレーム上に実装した多数の半導体素子を一括して樹脂封止することにより、面方向に連続する封止樹脂を成形するにあたって、従来から知られている成形用金型をそのまま採用することができなかった。すなわち、前述した従来の半導体バッケージの成形用金型では、キャビティ(半導体バッケージ)のサイズが、ゲートの接続部に対して大き過ぎることから、封止樹脂の充填時にキャビティ内の全面にわたって樹脂を充填することが難しく、未充填部分が生じたり、ボイドを生じたりするという不具合がある。また、樹脂の射出圧力を高圧にして充填した場合、ワイヤ流れを生じたりするおそれもあった。

【0010】また、上述した従来の成形用金型において、キャビティに対してゲートを数カ所に設けた場合においても、それぞれのゲートから流入した樹脂どおしが合流する部分において、ボイドの発生、樹脂フローマーク痕などの外観面での不具合が発生している。さらに、各ゲートから流入した樹脂の合流部分でワイヤ流れによるワイヤショートが発生するおそれもあった。

【0011】また、PBGA、CSP等の半導体パッケージは、パッケージの標準化が充分に確立しておらず、製品のバリエーションが多岐にわたっている。このため、従来の成形用金型において、各キャピティに樹脂封止を行うにあたって製品品質を維持するためには、半導体パッケージの配列に合わせてその都度ゲート位置の設計を行う必要がある。したがって、絶縁フレームサイズが同じであっても、半導体パッケージの配列、半導体素

子のサイズ、取り数等が異なると、金型を共通に使用することは不可能であった。

【0012】したがって、上述した従来から知られている成形用金型では、この金型を含めた専用の設備を半導05 体パッケージの種類毎に準備しなければならず、多大な設備投資が必要であり、汎用性を有する半導体パッケージの製造方法および設備の開発が要請されている。

【0013】一方、特開平6-244313号公報に記載された半導体パッケージでは、上述した通り、一列に 10 並べた半導体素子の連結部において切断により分割する 部分に薄肉部を形成し、さらに封止樹脂の該当部分も薄 肉部を形成している。したがって、半導体素子の連結部 への切削加工が必要となり、加工性の面で問題となるば かりでなく、樹脂封止時に全面にわたっての樹脂の充填 15 を確実に行うことが難しいという問題があった。

【0014】このような樹脂封止時の問題は、前記薄肉部に相当する部分を成形するために封止金型のキャビティ内に突部が形成されるため、樹脂の流れが遮られることにより、樹脂の充填を確実に行えない場合があるからである。また、この特開平6-244313号公報に記載された半導体バッケージは基本的にSOJ型のものであって、各半導体バッケージの両側部に外部接続用のリード材を張り出させて形成することが必要であり、このため半導体素子を一列に並べて連設しているだけのもので、一括して樹脂封止することにより形成できる半導体バッケージの大きさや数量に限界がある。

【0015】本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、封止樹脂により全面にわたって一連に樹脂封止することにより面方向に連続する平らな面をもち複数の半導体パッケージを形成する板状のパッケージパネルを、封止樹脂の未充填箇所がなく、またワイヤ流れ、倒れ等のワイヤへの不具合をなくし、さらに絶縁フレームのサイズが同じであれば、製造する半導体パッケージの大きさが異なっても封入金型を共用化することができる半導体パッケージの製造方法およびその成形用金型を得ることを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】このような目的に応えるために本発明の請求項1に係る半導体パッケージの製造方法は、絶縁フレームの主面上にマトリックス状に実装した多数の半導体素子をトランスファ成形により樹脂封止することにより、複数の半導体パッケージを形成する半導体パッケージの製造方法であって、半導体素子を実装した絶縁フレームを成形用金型の同一キャビディ内に配置し、前記成形用金型に設けたポットから溶融樹脂をランナを介して供給し、前記キャビティの長辺部分にその長さとほぼ等しい長さで設けたゲートを介して前記を融樹脂を充填することにより、面方向に連続する平らな面をもった板状のパッケージパネルを成形し、このパッケージパネルを前記半導体パッケージ毎に切断すること

を特徴とする。

【0017】ここで、前記半導体素子を実装する絶縁フレームとしては、絶縁基板または絶縁テープのいずれかを用いる。

【0018】また、本発明の請求項3または請求項4に係る半導体バッケージの成形用金型は、絶縁フレームの主面上にマトリックス状に実装した多数の半導体素子をトランスファ成形により樹脂封止することにより、面方向に連続する平らな面をもち複数の半導体バッケージを構成する板状のバッケージパネルを製造する半導体バッケージの成形用金型であって、前記半導体素子を実装した絶縁フレームを配置するキャビティと、このキャビティ内に複数のランナおよびゲートを介して溶融樹脂を供給する一個または複数個のポットとを備え、前記ゲートを、前記キャビティの長辺部分に沿ってその長さとほぼ等しくかつ長さ方向に連続した平行な隙間によって形成したことを特徴とする。

【0019】また、本発明の請求項5に係る半導体パッケージの成形用金型は、前記キャビティのゲートと反対側の長辺部分にダミーキャビティを設けたことを特徴とする。ここで、上述した成形用金型は、キャビティとダミーキャビティとの間に、前記キャビティの長辺部分に沿ってその長さとほぼ等しくかつ長さ方向に連続した平行な隙間を設けている。

【0020】請求項1に係る発明によれば、成形用金型のキャピティサイズの長辺部分の長さと同じ長さをもつゲートから溶融樹脂を一辺の全域からキャピティ内に流入させることができるから、溶融樹脂をキャピティ内に全面にわたってほぼ均一に流動させて充填することができ、複数の半導体パッケージを形成する板状のパッケージパネルの樹脂封止を確実に行える。

【0021】また、上述したゲートによれば、このゲート部分に一旦蓄えた溶融樹脂に射出圧力を作用させることにより、キャビティの長辺部分の全域からキャビティ内の全面にわたってほぼ均一に注入して充填することができる。したがって、絶縁フレーム上の半導体素子の配置による影響を受けることがなくキャビティ内への溶融樹脂の充填を均一に行えるから、絶縁フレームのサイズを統一すれば、異なる半導体パッケージの製造工程に成形用金型を共用化することができる。

【0022】また、請求項3に係る発明によれば、ゲートに対してその幅方向に分配させて接続した複数のランナから溶融樹脂を流入させ、一旦蓄えてからキャビティ内に長辺部分の全域から全面にわたって均等に注入させることができる。

【0023】さらに、請求項5または請求項6に係る発明によれば、キャビティ内にゲートから充填する溶融樹脂が、ダミーキャビティ内に入るからダミーキャビティ側からの跳ね返りがなく円滑に流れるため、キャビティ内の全面にわたっての溶融樹脂のほぼ均一な充填をより

確実に行える。

【0024】ポットは、キャビティの長辺部分に沿ってほぼ等しい長尺なゲートに対して複数個を並設するとよいが、これに限らず、サイズによっては一個のポットを05 ゲートに対して設けてもよい。また、上述したポットから供給する樹脂としては、熱硬化性樹脂、特にロングゲルタイプの熱硬化性樹脂を用いるとよい。

[0025]

【発明の実施の形態】図1ないし図6は本発明に係る半 導体パッケージの製造方法およびその成形用金型の一つ の実施の形態を示すものである。これらの図において、 本発明を特徴づける半導体パッケージ10は、図4に示すように、ポリイミドテープ等による絶縁フレーム11 の主面上に実装した半導体素子12と、これらをトラン スファ成形により樹脂封止することにより絶縁フレーム 11の主面の全面を面方向に連続する平らな面をもつように覆う封止樹脂13と、半導体素子12を外部に接続するように前記絶縁フレーム11の裏面に形成した複数のボールパンプ14とから構成されている。

20 【0026】ここで、上述した半導体パッケージ10によれば、半導体パッケージ10の外周面すなわち四つの側面を、主面に垂直な切断面10aにより形成している。なお、図4中15は前記絶縁フレーム11上に所要の配線パターンで形成された銅箔、16はこの銅箔15と前記半導体素子12の電極とを接続するワイヤ、17は半導体素子12を絶縁フレーム11の主面上に搭載するための接着剤である。

【0027】このような半導体バッケージ10の製造方法を、図5および図6を用いて説明する。絶縁フレーム 30 11の主面上に、図4および図5(a)に示すように銅箔15、接着剤17を介して多数の半導体素子12をマトリックス状に配列して実装する。

【0028】このとき、隣接する半導体素子12間の間隔は従来のパッケージ構造のように切断代を必要とするものとは異なり、たとえばワイヤ7による配線が行える等のように半導体パッケージ10を構成するに充分な封止樹脂の厚みが両側に得られる程度の間隔であればよい。なお、絶縁フレーム11上の配線パターンと半導体素子12との接続をパンプで行うフェースダウンタイプでは、それぞれのパッケージ10における半導体素子12の側部を樹脂封止するに必要な間隔をおいて配列することができる。

【0029】上述した絶縁フレーム11上の多数の半導体素子を、図5(b)に示すように、半導体素子12, 45 12間を仕切ることなく表面が平らな面をもつように封止樹脂13により一括して樹脂封止する。この結果、周縁部にわずかに絶縁フレーム11が蠶呈するが、全体として面方向に連続する平らな面をもった板状のパッケージパネル18を形成することができる。

50 【0030】次に、この樹脂封止することによって得ら

れた板状のパッケージパネル18において、絶縁フレーム11の裏面で各半導体素子12に対応する位置に、半田ボールを搭載することによりボールパンプ14を設ける。

【0031】そして、このように板状に形成したパッケージパネル18を、ダイシング装置の作業台上にマウントし、円形ブレード19により、図5(c)中一点鎖線で示すような切断線に沿って、半導体素子12,12間をダイシング切断することにより、個々の半導体パッケージ10に個片化される。そして、各半導体パッケージ10では、その四つの側面が主面に対して垂直な切断面10aとなる。

【0032】ここで、このようなパッケージパネル18の切断は、図6に示すように、円形プレード19の回転により砥粒加工切断を行うダイシング装置を用いて行う。このような円形プレード19の切断刃の刃幅は約 150μ m程度であり、従来のパンチとダイとによる切断金型のような切断代は必要ない。なお、図6では切断線を二本の線によって積極的に図示しているが、実際には切断幅はほとんど必要ない。

【0033】なお、上述したパッケージパネル18のダイシング切断時には冷却水が供給される。この冷却水によってフラックス洗浄が行われることになる。このことは、従来の半導体パッケージの製造工程において、切断工程とは別に必要であったフラックス洗浄工程を、切断工程と同時に行えるということを意味する。その後は、各半導体パッケージ10に捺印等が行われ、製品となる。

【0034】上述した構成による半導体パッケージ10の製造方法によれば、面方向に連続する平らな面をもった板状のパッケージパネル18を樹脂封止によって形成し、この板状のパッケージパネル18を半導体パッケージ10毎に切断手段(円形ブレード19)により切断するだけで、四側面が主面に垂直な切断面となるように製造された半導体パッケージ10を、簡単にしかも確実に個片化して形成することができる。

【0035】上述した半導体パッケージ10の製造工程において、絶縁フレーム11の主面上にマトリックス状に実装した多数の半導体素子12をトランスファ成形により樹脂封止することにより、面方向に連続する平らな面をもち複数の半導体パッケージ10を構成する板状のパッケージパネル18を製造するにあたって、以下のような成形用金型20を用いている。

【0036】半導体バッケージ10の成形用金型20は、図1(a),(b)に示すような構造を有する。これらの図において、成形用金型20は上型21と下型22とを備え、これらの上型21と下型22とによって、前記板状パッケージパネル18における封止樹脂13の樹脂封止を行うキャビティ23が形成されている。なお、図1(a)に示すように、下型22のキャビティ2

3 bが、前記絶縁フレーム11を配置する部分であり、 上型21のキャビティ23 aが前記絶縁フレーム11上 に実装した半導体素子12を配置するとともにこれらを 覆う封止樹脂13を成形する部分である。

05 【0037】前記上型21と下型22の図1(a)中右側部分には、上型センタブロック24と下型センタブロック25とが設けられている。なお、半導体パッケージ10の樹脂封止装置では、一般的に上述したセンタブロック24,25の図中右側にも、前述したと同様の上型1021と下型22とを配置し、前記ポット27からの溶融樹脂を充填するように構成されるが、ここでの説明は省略する。

【0038】前記下型センタブロック25には、樹脂26を装填するポット27と、このポット27内の樹脂26に加圧力を与えるプランジャ28とが設けられている。また、前記上型センタブロック24の前記ポット27に対向する位置にはカル29が設けられている。このカル29の両側には前記キャビティ23側に溶融樹脂26を流し込む流路となるランナ30が形成され、このランナ30は前記キャビティ23への注入口であるゲート31に接続されている。

【0039】本発明によれば、上述した板状パッケージパネル18を樹脂封止によって形成するように面方向(幅方向および奥行き方向)に広がりをもつキャビティ2523に対して溶融樹脂26を全面にわたって均一に流入させて充填するために、キャビティ23の長辺部分に沿ってその長さとほぼ等しくかつ長さ方向に連続する平行な隙間31aを有するゲート31を設けている。

【0040】このようなゲート31を用いると、ポット 27からカル29、ランナ30を介して供給されてくる 溶融樹脂26を一旦蓄え、射出圧力がこの溶融樹脂26 に作用すると同時にキャピティ23の長辺部分の全域か らキャピティ23内にほぼ均一に注入され、キャピティ 23の全面にわたってほぼ均一に充填することができ る。したがって、絶縁フレーム11上の半導体素子12

35 る。したかって、紀縁ノレーム11上の半導体系子12 の配置による影響を受けることがなくキャビティ23内 への溶融樹脂26の充填を均一に行える。本発明に係る 成型用金型20によれば、絶縁フレーム11のサイズを 統一すれば、半導体素子の数や大きさが異なっている半 40 導体パッケージの製造にあたっても、この成形用金型2 0を共用化することができる。

【0041】また、本発明によれば、図1(b)に示すように、このゲート31の長手方向(幅方向)に対して複数のランナ30を分配して接続している。なお、この 実施の形態によれば、複数個のポット27とこれに対向する複数個のカル29とを前記ゲート31の長手方向に沿って等間隔に配設し、それぞれのポット27(カル29)から二本ずつのランナ30,30を前記ゲート31の長手方向に対して等配させた状態で連結している。

50 【0042】このように複数のランナ30をゲート31

の長手方向に対してほぼ等配させた位置に連結することにより、長尺なゲート31の全体にわたっての溶融樹脂26の注入をほぼ均一に行なえ、このゲート31からのキャビティ23への均一な注入を適切に行うことが可能となる。

【0043】したがって、従来の成形用金型においてたとえば複数のゲートをキャビティに設けるにあたって、絶縁フレーム11上の半導体素子12間に対向する位置にゲートを設けたりした場合に、半導体素子12間の間隙での樹脂の充填が進み、半導体素子12の上面には樹脂の未充填といった不具合を発生するおそれがあったが、本発明のような長尺なゲート31ではこのような問題は発生しない。また、上述した本発明によれば、溶融樹脂26の充填をバッケージパネル18の幅方向の全面にわたって均一に充填することができるから、従来問題であった封入樹脂26のキャビティ23内への未充填やワイヤ流れ、ワイヤの倒れ等のワイヤ16への不具合を低減することができる。

【0044】さらに、この実施の形態では、上述したキャピティ23の長尺なゲート31と反対側の長辺部分に、ダミーキャピティ32を設けている。前記キャピティ23とこのダミーキャピティ32との間には、前記キャピティ23の長辺部分に沿ってその長さとほぼ等しくかつ長さ方向に連続する平行な隙間を設けている。

【0045】このようなダミーキャビティ32を設けると、キャビティ23内にゲート31から充填する溶融樹脂26が、充填時においてダミーキャビティ32内に入るから、このダミーキャビティ32側からの跳ね返りがなく円滑に流れるため、キャビティ23内の全面にわたっての溶融樹脂26のほぼ均一な充填をより確実に行える。したがって、樹脂封止時において、絶縁フレーム11上に実装した半導体素子12やワイヤ16によって樹脂の流れが遮られたり、未充填、あるいはワイヤ流れ等の問題はない。このようなダミーキャビティ32がないとゲート31の対向辺部分に先に到達した樹脂が跳ね返って樹脂の充填が遅れている部分に逆流し、正規の流れと衝突したところでワイヤ変形やボイドが発生することを避けられないもので、ダミーキャビティ32を設けるとこのような問題を解消することができる。

【0046】なお、上述した成形用金型20による樹脂封止は、図2および図3に示すように行われる。図2(a)に示すように、上、下型21,22(センタブロック24,25を含む)を型開きし、キャピティ23内に半導体素子12を実装した絶縁フレーム11を配置し、またポット27部分に固形または顆粒タイプの樹脂26を入れる。

【0047】そして、図2(b)に示すように、上、下型21, 22を型締めし、この状態で前記ポット27に装填した固形の樹脂26を図示しない加熱源で加熱した状態でプランジャ28を押し上げると、図2(c)に示

すように、溶融した樹脂26は前記カル29に流入し、 さらにこのカル29からランナ30を経てゲート31に 達する。

【0048】この溶融樹脂26は、長尺なゲート31の 05 隙間31aに流れを阻止される状態となり、長辺方向に 拡がり一旦蓄えられたような状態を経て、所定の射出圧 力が作用することにより、キャビティ23内に長辺部分 から一斉に注入されて、図2(d)および図3(b)に 示すようにキャビティ23の全面にわたってほぼ均一に 10 充填されることになる。

【0049】以上のような本発明に係る半導体バッケージの製造方法によれば、従来と同じ大きさの絶縁フレーム11上に半導体素子12を実装するにあたって、余分な切断代を設ける必要がないから、従来よりも高密度に15 実装することができる。そして、このような構成では、板状のバッケージバネル18から多数の半導体バッケージ10を形成することができるものであり、多数個取りによる量産効果を発揮させることができる。

【0050】従来は絶縁フレーム11上に3列18行の20 マトリックス配列で半導体素子12を設けていたのに対し、本発明によれば、同じ大きさの絶縁フレーム11上に5列27行のマトリックス配列で半導体素子12を並べて実装することができる。このことは本発明によれば、従来のような切断代は不要であり、比較的高価な絶25 縁フレーム11の材料費を無駄なく使用することができることを意味する。

【0051】このような本発明によれば、従来と同じ大きさの絶縁フレーム11から約2~3倍程度多くの半導体パッケージ10が得られることが試作により確認されている。また、従来のように一つまたは複数個の半導体素子12年に封止樹脂13を樹脂封止する場合に比べて、樹脂封止処理がきわめて簡単に行なえ、しかも樹脂封止用の金型も簡単な構造でよい。

【0052】なお、本発明は上述した実施の形態で説明 15 した構造には限定されず、各部の形状、構造等を適宜変 形、変更し得ることはいうまでもない。たとえば上述した実施の形態では、面方向に連続する平らな面をもった 板状のパッケージパネル18を所定の大きさに切断する ために、ダイシング装置の円形ブレード19を用いた が、本発明はこれに限定されず、切断手段としてレーザ

加工や放電加工等を利用してもよい。 【0053】また、上述した実施の形態では、絶縁フレ

ーム11としてポリイミドテープ等の絶縁テープを用いた場合を例示したが、本発明はこれに限定されず、ガラ 45 エポ基板等の絶縁基板を用いてもよい。さらに、上述した実施の形態では、樹脂封止をトランスファ成形によって行っているが、これに限定されない。

【0054】また、上述した実施の形態では、半導体パッケージの四側面を主面に垂直な切断面とした場合を説 50 明したが、この切断面の角部に面取りが形成されるよう に、樹脂封止によって得られる封止樹脂13の表面において、円形プレード等の切断手段による切断線部分に浅い V溝、その他の凹溝を形成し、切断したときに面取りが残るように構成してもよい。要するに、切断によって得られる半導体パッケージにおいて、四側面のほとんどが主面に実質的に垂直な切断面であって、余分な切断代がなく、結果として半導体素子を絶縁フレーム上に高密度に実装できる構成であればよい。

【0055】また、上述した実施の形態では、成型用金型20において、キャピティ23の長辺部分にほぼ等しい長さをもつ長尺なゲート31を設けているが、本発明はこれに限らず、長辺部分の長さと短辺部分の長さとの比率が小さいときには、短辺部分に沿ってその長さとほぼ等しくかつ長さ方向に連続した平行な隙間をもつゲートを設け、このゲートから樹脂を充填することにより絶縁フレーム11上に実装した半導体素子12の樹脂封止を行ってもよい。

[0056]

【実施例】絶縁フレーム11上に実装した半導体素子12を樹脂封止する封止樹脂13として、たとえばエポキシ系樹脂のような熱硬化性樹脂を用いる。特に、ロングゲルタイプの熱硬化性樹脂を用いると、樹脂のキャビティ23内への充填時間や熱硬化時間を長くすることができるから、面方向に拡がりをもった絶縁フレーム11の全面にわたって一連に樹脂封止することがよい一層確実に行える。

[0057]

【発明の効果】以上説明したように本発明(請求項1)に係る半導体パッケージの製造方法によれば、複数の半導体パッケージを形成する板状パッケージパネルにおいて、面方向に連続する平らな面をもつ封止樹脂を樹脂封止するための成形用金型におけるキャピティの長辺部分にほぼ等しい長さで設けた長尺なゲートから溶融樹脂を注入することができるから、たとえばロングゲルタイプの熱硬化性樹脂等による溶融樹脂を一辺の全域からキャピティ内に全面にわたってほぼ均一に流動させて充填することができる。

【0058】そして、このような本発明によれば、溶融 樹脂の充填をパッケージパネルの幅方向の全面にわたっ て均一に充填することができるから、従来問題であった 封入樹脂のキャピティ内への未充填やボイド、あるいは ワイヤ流れ、ワイヤの倒れ等のワイヤへの不具合を低減 することができる。

【0059】さらに、このような本発明によれば、上述した長尺なゲートに一旦蓄えた溶融樹脂に射出圧力を作用させることにより、キャピティの長辺部分の全域からキャピティ内の全面にわたってほぼ均一に注入して充填することができる。したがって、絶縁フレーム上の半導体素子の配置による影響を受けることがなくキャピティ

内への溶融樹脂の充填を均一に行えるから、絶縁フレームのサイズを統一すれば、異なる半導体パッケージの製造工程に成形用金型を共用化し、半導体パッケージの製造コストを低減することができる。

05 【0060】また、本発明(請求項3)に係る半導体バッケージの成形用金型によれば、キャビティの長辺部分に沿って設けた長尺なゲートとその幅方向に対して分配して接続した複数のランナとによって、ゲートに対して複数のランナから溶融樹脂をほぼ均等に流入させ、一旦
10 蓄えてからキャビティ内に長辺部分の全域から全面にわたって均一に注入させることができる。これによって、キャビティ内への溶融樹脂の充填をキャビティ全面に対してほぼ均一に行える。

【0061】さらに、本発明(請求項5または請求項156)に係る半導体パッケージの成形用金型によれば、キャビティ内にゲートから供給される溶融樹脂が、長尺なゲートの反対側に設けたダミーキャビティ内に入るから、ダミーキャビティ側からの跳ね返りがなく円滑に流れるため、キャビティ内の全面にわたっての溶融樹脂の20ほぼ均一な充填をより一層確実に行える。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a), (b)は本発明に係る半導体バッケージの製造方法およびその成形用金型の一つの実施の形態を示し、成形用金型の要部平面図およびそのI-I線25 断面図である。

【図2】 (a),(b),(c),(d)は図1 (b)に示す成形用金型における溶融樹脂の充填過程を 説明する断面図である。

【図3】 (a), (b)は図1 (a)に示す成形用金 30 型における溶融樹脂の充填過程を説明する平面図であ る。

【図4】 本発明で製造する半導体パッケージを例示する断面図である。

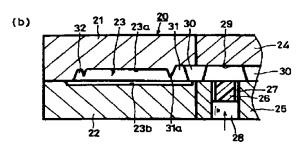
【図5】 (a), (b), (c) は本発明に係る製造 35 方法により半導体パッケージを形成するパッケージパネルの製造工程を説明する説明図である。

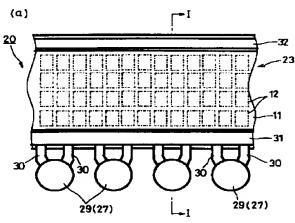
【図6】 本発明に係る半導体パッケージの製造方法において、パッケージパネルの切断によって半導体パッケージを得る状態を説明する斜視図である。

40 【符号の説明】

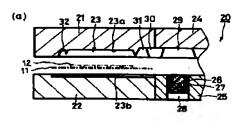
10…半導体パッケージ、11…絶縁フレーム、12… 半導体素子、13…封止樹脂、14…ポールパンプ、1 8…パッケージパネル、19…円形プレード(切断手 段)、20…成形用金型、21…上型、22…下型、2 45 3(23a,23b)…キャピティ、24…上型センタ ブロック、25…下型センタブロック、26…溶融樹 脂、27…ポット、28…プランジャ、29…カル、3 0…ランナ、31…ゲート、32…ダミーキャピティ。

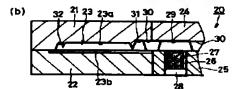
【図1】

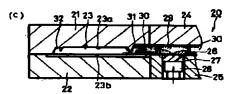


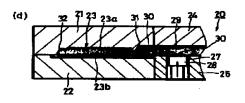


【図2】

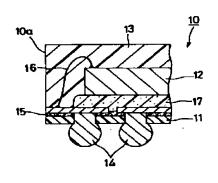








【図4】



【図6】

